

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 8 月 18 日 (2005.8.18)

【公開番号】特開 2004-228601 (P2004-228601A)

【公開日】平成 16 年 8 月 12 日 (2004.8.12)

【年通号数】公開・登録公報 2004-031

【出願番号】特願 2004-127686 (P2004-127686)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/31

C 2 3 C 16/455

【F I】

H 0 1 L 21/31 B

C 2 3 C 16/455

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 3 月 31 日 (2005.3.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】反応容器

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の基板を収納可能な反応室を形成し、

ガス導入部と、

バッファ室と、を備えた細長形状の反応容器であって、

前記ガス導入部は、処理ガスを前記バッファ室に導入可能であって、反応容器の長手方向に沿って設けられ、

前記バッファ室は、反応容器の内部に設けられ、反応容器の長手方向に沿って設けられた複数のガス供給口を有し、前記ガス導入部から導入される前記処理ガスを前記複数のガス供給口から前記反応室に供給可能であって、前記バッファ室がプラズマ発生用の電極を収容する空間を形成することを特徴とする反応容器。

【請求項 2】

複数の基板を収納可能な反応室を形成し、

複数のバッファ室と、

処理ガスを前記複数のバッファ室にそれぞれ導入可能な複数のガス導入部と、を備えた細長形状の反応容器であって、

前記複数のバッファ室は、それぞれ反応容器の内部に設けられ、反応容器の長手方向に沿って設けられた複数のガス供給口をそれぞれ有し、前記複数のガス導入部からそれぞれ導入される前記処理ガスを前記複数のガス供給口から前記反応室にそれぞれ供給可能であって、前記バッファ室の少なくとも一つがプラズマ発生用の電極を収容する空間を形成することを特徴とする反応容器。

【請求項 3】

前記複数のガス導入部の少なくとも一つは、反応容器の長手方向に沿って設けられていることを特徴とする請求項 2 記載の反応容器。

【請求項 4】

複数の基板を収納可能な反応室を形成し、

ガス導入部と、

バッファ室と、を備えた細長形状の反応容器であって、

前記ガス導入部は、処理ガスを前記バッファ室に導入するように設けられ、

前記バッファ室は、反応容器の内部に設けられ、反応容器の長手方向に沿って設けられた複数のガス供給口を有し、前記ガス導入部から導入される前記処理ガスを前記複数のガス供給口から前記反応室に供給可能であって、前記バッファ室がプラズマ発生用の電極を収容する空間を形成することを特徴とする反応容器。